

세리아 연마제 첨가에 따른 산화막 CMP 특성 연구

한상준, 이영균, 박성우, 서용진*, 이우선
조선대학교 전기공학과, 대불대학교 전기공학과*

A Study on the Oxide CMP Characteristics According to the CeO₂ Abrasive Adding

Sang-Jun Han, Young-Kyun Lee, Sung-Woo Park, Yong-Jin Seo* and Woo-Sun Lee

Department of Electrical Engineering, Chosun University, Department of Electrical Engineering, Daebul University.*

Abstract : 본 논문에서는 기존에 상용화된 슬러리에 비해 새로운 혼합 연마제 슬러리의 우수성을 입증하고, 최적화된 공정기술을 연구의 기반으로 활용하고자 Silica slurry에 CeO₂ 연마제를 혼합하여, 어떠한 연마 특성을 나타내는지 알아보았고, AFM, EDX, XRD, TEM 분석을 통해 그 가능성을 비교 분석하였다.

Key Words : Oxide-CMP, CeO₂, mixed abrasive slurry (MAS)